

Panier De Nettoyage Et Porte-Wafers Ptfé Personnalisé Résistant À La Corrosion Non Lixivable Support Pour Expériences De Polymères De Haute Qualité

Numéro d'article: PL-CP264



Introduction

Porte-wafers et paniers de nettoyage PTFE personnalisés haute performance conçus pour la recherche dans les domaines des semi-conducteurs et des polymères. Offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et des propriétés de non-lixiviation, ces solutions sur mesure garantissent un traitement sans contamination dans des environnements chimiques exigeants pour les applications de laboratoire de haute précision et industrielles d'aujourd'hui.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Gravure humide de semi-conducteurs	Maintien des wafers de silicium lors des processus de gravure à base d'acide pour éliminer les oxydes ou définir des motifs.	L'inertie chimique empêche la contamination du bain.
Analyse de traces métalliques	Nettoyage de la verrerie et des échantillons dans des bains d'acide haute pureté pour la recherche environnementale ou géologique.	L'absence de lixiviation métallique garantit la précision analytique.
Synthèse de polymères	Support des porte-catalyseurs ou substrats lors de réactions à base de solvants à haute température.	Haute résistance thermique et surface antiadhésive.
Fabrication de cellules solaires	Transport de substrats de silicium grand format à travers des bains de nettoyage et de texturation multi-étapes.	Construction robuste pour un débit à grand volume.
Nettoyage pharmaceutique	Stérilisation et nettoyage de composants délicats en verre ou métal dans des solutions détergentes agressives.	Conformité aux normes de haute pureté et de non-contamination.
Dépôt électrochimique	Maintien des substrats lors du placage métallique ou du dépôt dans des solutions électrolytiques corrosives.	Isolation électrique et stabilité chimique.
Traitement optoélectronique	Nettoyage et manipulation de substrats en verre ou en saphir pour la fabrication de LED et de diodes laser.	Manipulation sans rayures et rinçage sans résidus.
Séchage à haute température	Transfert des wafers des bains humides directement vers des chambres de séchage chauffées ou des fours.	Conserve l'intégrité structurelle jusqu'à 260 °C.

Caractéristique	Détails de la spécification (Série PL-CP264)
Identification du produit	Porte-wafers personnalisé PL-CP264
Matériau principal	PTFE vierge haute pureté (PFA optionnel disponible)
État de personnalisation	100 % sur mesure / Fabriqué à la commande
Plage de température	-200 °C à +260 °C (-328 °F à +500 °F)
Compatibilité chimique	Universelle (Tous acides, bases, solvants, sauf métaux alcalins fondus)

Application	Description	Avantage clé
Caractéristique	Détails de la spécification (Série PL-CP264)	
Configuration des fentes	Personnalisable (Largeur, Pas, Angle et Profondeur)	
Compatibilité des wafers	Tailles personnalisées pour 1", 2", 4", 6", 8", 12" ou formes non standard	
Méthode de fabrication	Usinage CNC de haute précision	
Finition de surface	Lisse, faible frottement, non poreux	
Options de poignée	Intégrée, Détachable ou Interface robotique	
Capacité du lot	Conçu selon les spécifications de l'utilisateur (Wafer unique ou multiple)	